X線光電子分光によるルチル型 Sn_{1-x}Ge_xO₂薄膜のバンド端エネルギー評価

Evaluation of band alinement of rutile-Sn_{1-x}Ge_xO₂ by XPS 東大院理¹, お茶大理², 都立大院理³ ^O長島 陽¹, 近松 彰², 廣瀬 靖³ Univ. of Tokyo¹, Ochanomizu Univ.², Tokyo Metropolitan Univ.³ ^oYo Nagashima¹, Akira Chikamatsu² and Yasushi Hirose³ E-mail: nagashima@chem.s.u-tokyo.ac.jp

【背景】代表的な酸化物半導体であるSnO2にGeO2を固溶したルチル型Sn1-xGexO2(SGO)は、バンドギャップを~3.7 eV ~ ~4.7 eV の範囲で変調可能な超ワイドギャップ半導体で、パワーエレクトロニクスデバイスや紫外オプトエレクトロニクスデバイス材料として期待されている[1,2]。また、第一原理計算によるとGe 固溶量の増大に伴って価電子帯上端(VBM)が大きく上昇することから、p型ドーピングの可能性も提案 されている[2-4]。これらの特性を生かしたデバイス応用にはバンド端のエネルギーを実験的に評価する 必要があるが、我々の知る限り報告はない。今回はX線光電子分光法(XPS)を用いてSGO薄膜(x=0-0.52)のVBMを評価したので報告する。

【結果と考察】パルスレーザー堆積法を用いて Nb:TiO₂ (001)基板上に SGO 薄膜をエピタキシャル成長 した[1]。結晶構造と組成は X 線回折およびエネルギー分散型 X 線分光により確認した。合成した SGO 薄膜は大気雰囲気中、850 °C で 8 時間アニールして表面の Sn²⁺不純物を除いた後、O 1s 内殻電子およ び価電子帯の XPS スペクトルを測定した。O 1sピークを基準として真空準位からのエネルギーを計算した 価電子帯スペクトルを Fig. 1 に示す。Ge 含有量 x の増大に伴って VBM は上昇し、第一原理計算による 予想[2-4]と定性的に一致した。また、光学測定から求めた SGO の組成とバンドギャップの関係[1]を用い て伝導帯下端(CBM)のエネルギーを計算した結果、SGO と SnO₂ はタイプ II 型のヘテロ接合を形成する ことが実験からも示唆された(Fig. 2)。

【参考文献】[1] Y. Nagashima *et al.*, Chem. Mater. 34, 24, 10842 (2022). [2] H. Takane *et al.*, Phys. Rev. Materials 6, 084604. (2022). [3] S. Chae *et al.*, Appl. Phys. Lett. 114, 102104 (2019). [4] C. A. Niedermeier *et al.*, J. Phys. Chem. C 124, 47, 25721–25728. (2020).



Fig. 1 (a) Valence band XPS spectra of the SGO thin films on Nb:TiO₂ (001) substrate with various Ge content *x*. (b) Enlarged spectra of (a) around the VBM.



Fig. 2 VBM and CBM position of the SGO thin films determined by the XPS measurements. Energy from the vacuum level was calibrated with the O 1s peak position. Energy of the CBM was calculated from the VBM position and the optical bandgap estimated from the Ge content x in the film [1].